

Актуальный перечень аналитического оборудования ЦКП ИФМ РАН и
вспомогательного технологического оборудования

1.	Дифрактометр рентгеновский XPert PRO MRD (Philips)
2.	Дифрактометр рентгеновский PANalytical XPert PRO MRD
3.	Лазерно-плазменный источник рентгеновского излучения
4.	Сканирующий зондовый микроскоп Solver PRO-HV (НТ-МДТ)
5.	ИК-Фурье спектрометр BOMEM DA3.36
6.	ИК-Фурье спектрометр Vertex 80V (Bruker)
7.	Фурье-спектрометр Инфралюм ФТ-801
8.	Сканирующий электронный микроскоп Supra 50VP (Carl Zeiss)
9.	Измерительная система Talysurf CCI 2000 (Taylor)
10.	Вторично-ионный масс-спектрометр TOF-SIMS 5-100 (IONTOF)
11.	Установка реактивного ионного травления с источником индуктивно связанной плазмы PlasmaLab 80
12.	Сверхпроводящая магнитная система
13.	Анализатор спектра Agilent 4407B
14.	Двухлучевая система с высоким разрешением для исследования и подготовки образцов Neon-40 (Carl Zeiss)
15.	Цифровой осциллограф
16.	Дифрактометр рентгеновский D8 Discover
17.	Лазерный генератор микро-изображений mPG101
18.	Станция ожижения гелия Cryomech LHeP18 с системой сбора газообразного гелия
19.	Генератор сигналов Agilent Technologies E8257D
20.	Атомно-силовой микроскоп Ntegra Prima
21.	Сканирующий мульти-микроскоп СММ-2000
22.	Вакуумная установка резистивного и электронно-лучевого испарения с холловским ионным источником Amod 206
23.	Автоэмиссионный просвечивающий электронный микроскоп LIBRA® 200MC
24.	Профилометр модели 130 (Протон-МИЭТ)
25.	Анализатор спектра Rohde&Schwarz FPC 1000
26.	Оптический рефлектометр KIWI-7221
27.	Комплект оборудования подготовки объектов для электронной микроскопии с установкой ионного травления (Balzers)
28.	Комплект вакуумного оборудования с системой виброзащиты для вакуумного сканирующего зондового микроскопа
29.	Сканирующий зондовый микроскоп «Solver-P7LS»
30.	Аппаратно-программный комплекс электронной литографии ELPHY PLUS
31.	Система очистки образцов и рабочей камеры микроскопа с помощью кислородной плазмы
32.	Установка магнетронного напыления тонких пленок
33.	Установка совмещения и экспонирования для получения заданного рисунка микронного разрешения на плоских подложках методом фотолитографии
34.	Установка для напыления (металлов, диэлектриков, сверхпроводников, органических полупроводников)
35.	Установка для быстрой температурной обработки микроструктур AcuThermo AW 410 System
36.	Установка экспонирования контактной фотолитографии SUSS MJB4
37.	Стенд для измерения магнитооптических эффектов Керра и Фарадея в тонких магнитных плёнках

38.	Стенд ионно-пучкового травления
39.	Установка магнетронно-ионного напыления многослойных структур
40.	Установка магнетронного распыления
41.	Стенд рентгеновской спектроскопии для диапазона 0,8-200 нм
42.	Стенд спектральных измерений на основе лазерно-плазменного источника 4-50 нм